

(別添5)

20100310 特許 006

知的財産権制度関係功労者に対する経済産業大臣表彰要領（22 特第 58 号）及び知的財産権制度関係功労者に対する特許庁長官表彰要領（20100310 特許 003）に基づく被表彰者の内部選考基準を次のように定める。

平成 22 年 4 月 1 日

特許庁長官 細野 哲弘

改正 20140227 特許 1（平成 26 年 4 月 7 日）

#### 知的財産権制度関係功労者表彰の被表彰者選考基準

（趣旨）

第 1 条 被表彰者の選考は、候補者の功績内容について、知的財産権制度関係功労者表彰実施要領（20100310 特許 005）第 5 条の留意事項に基づき、選考委員会で審査するものとする。

（行刑罰）

第 2 条 過去において、行政処分・刑事罰等を受けた者または調査中の者は、原則、被表彰者から除くものとする。

附 則

第 1 条 この基準は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

第 2 条 産業財産権制度関係功労者表彰の被表彰者選考基準（20041214 特許 009）は、廃止する。

附 則

この基準は、平成 26 年 4 月 7 日から施行する。